



PROJET D'AMENDEMENT ISO 4287:1997/DAM 2

ISO/TC 213

Secrétariat: DS

Début de vote
2013-04-11

Vote clos le
2013-09-11

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Spécification géométrique des produits (GPS) — État de surface: Méthode du profil — Termes, définitions et paramètres d'état de surface

AMENDEMENT 2

Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters

AMENDMENT 2: Parameters Xsm and Xc

ICS 81.040.17; 17.040.20

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

TRAITEMENT PARALLÈLE ISO/CEN

Le présent projet a été élaboré dans le cadre de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et soumis selon le mode de collaboration **sous la direction de l'ISO**, tel que défini dans l'Accord de Vienne.

Le projet est par conséquent soumis en parallèle aux comités membres de l'ISO et aux comités membres du CEN pour enquête de cinq mois.

En cas d'acceptation de ce projet, un projet final, établi sur la base des observations reçues, sera soumis en parallèle à un vote d'approbation de deux mois au sein de l'ISO et à un vote formel au sein du CEN.

Pour accélérer la distribution, le présent document est distribué tel qu'il est parvenu du secrétariat du comité. Le travail de rédaction et de composition de texte sera effectué au Secrétariat central de l'ISO au stade de publication.

To expedite distribution, this document is circulated as received from the committee secretariat. ISO Central Secretariat work of editing and text composition will be undertaken at publication stage.

CE DOCUMENT EST UN PROJET DIFFUSÉ POUR OBSERVATIONS ET APPROBATION. IL EST DONC SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION ET NE PEUT ÊTRE CITE COMME NORME INTERNATIONALE AVANT SA PUBLICATION EN TANT QUE TELLE.

OUTRE LE FAIT D'ÊTRE EXAMINÉS POUR ÉTABLIR S'ILS SONT ACCEPTABLES À DES FINS INDUSTRIELLES, TECHNOLOGIQUES ET COMMERCIALES, AINSI QUE DU POINT DE VUE DES UTILISATEURS, LES PROJETS DE NORMES INTERNATIONALES DOIVENT PARFOIS ÊTRE CONSIDÉRÉS DU POINT DE VUE DE LEUR POSSIBILITÉ DE DEVENIR DES NORMES POUVANT SERVIR DE RÉFÉRENCE DANS LA RÉGLEMENTATION NATIONALE.

LES DESTINATAIRES DU PRÉSENT PROJET SONT INVITÉS À PRÉSENTER, AVEC LEURS OBSERVATIONS, NOTIFICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ DONT ILS AURAIENT ÉVENTUELLEMENT CONNAISSANCE ET À FOURNIR UNE DOCUMENTATION EXPLICATIVE.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

ISO 4287:1997/DAmD 2

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a2dd5de6-ff40-4ce5-b931-59186a493f7c/iso-4287-1997-damd-2>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2013

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos **iv**
Introduction..... **v**

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 4287:1997/DAmD 2

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a2dd5de6-ff40-4ce5-b931-59186a493f7c/iso-4287-1997-damd-2>

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'Amendement 2 à l'ISO 4287:1997 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 213, *Spécifications et vérification dimensionnelles et géométriques des produits* et par le comité technique CEN/TC 290, *Spécification dimensionnelle et géométrique des produits, et vérification correspondante* en collaboration.

[ISO 4287:1997/DAmD 2](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a2dd5de6-ff40-4ce5-b931-59186a493f7c/iso-4287-1997-damd-2)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a2dd5de6-ff40-4ce5-b931-59186a493f7c/iso-4287-1997-damd-2>

Introduction

Le présent amendement 2 à la norme Internationale ISO 4287:1997 est une norme traitant de la spécification géométrique des produits (GPS) et doit être considérée comme une norme GPS générale (voir l'ISO/TR 14638). Elle influence le maillon 2 de la chaîne de normes sur l'état de surface.

L'amendement 2 à la norme Internationale ISO 4287:1997 définit les paramètres X_{Sm} et X_c pour état de surface et méthode du profil.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[ISO 4287:1997/DAmD 2](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a2dd5de6-ff40-4ce5-b931-59186a493f7c/iso-4287-1997-damd-2)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a2dd5de6-ff40-4ce5-b931-59186a493f7c/iso-4287-1997-damd-2>

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 4287:1997/DAmD 2

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a2dd5de6-ff40-4ce5-b931-59186a493f7c/iso-4287-1997-damd-2>

Spécification géométrique des produits (GPS) — État de surface : Méthode du profil — Termes, définitions et paramètres d'état de surface AMENDEMENT 2 : Paramètres Xsm et Xc

Page 5, article 3.1.9

Remplacer par :

3.1.9

longueur de base

l_p , l_r , l_w

longueur, dans la direction de l'axe des X, utilisée pour identifier les irrégularités caractérisant le profil à évaluer

NOTE La longueur de base des profils de rugosité l_r , est en valeur numérique égale à la longueur d'onde du filtre du profil λ_c quand elle existe. La longueur de base des profils d'ondulation, l_w , est en valeur numérique égale à la longueur d'onde du filtre du profil λ_f quand elle existe. Si λ_f n'est pas spécifié (ondulation latérale) alors la longueur de base des profils d'ondulation, l_w , est en valeur numérique égale à la longueur de base. La longueur de base du profil primaire, l_p , est égale à la longueur d'évaluation.

Page 6, article 3.2.6

Remplacer par :

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

3.2.6

discrimination de hauteur et/ou d'espacement

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a2dd5de6-ff40-4ce5-b931-59186a49317c/iso-4287-1997-damd-2>

3.2.6.1

discrimination de hauteur

hauteur minimale des saillies et hauteur minimale des creux du profil évalué qu'il convient de prendre en considération

NOTE La hauteur minimale des saillies et la hauteur minimale des creux du profil évalué sont habituellement spécifiées sous forme de pourcentage de P_z pour le calcul des paramètres de profil P, de W_z pour le calcul des paramètres de profil W, de R_z pour le calcul des paramètres de profil R. A la place de P_z , W_z ou R_z d'autres paramètres d'amplitude peuvent être utilisés.

3.2.6.2

discrimination d'espacement

espacement minimal des saillies ou des creux du profil évalué qu'il convient de prendre en considération

NOTE L'espacement minimal est habituellement spécifié en pourcentage de la longueur de base.

Page 7, article 3.2.7

Remplacer par :

3.2.7

élément du profil

saillie du profil suivie par un creux du profil ou creux du profil suivie par une saillie du profil à l'intérieur de la longueur d'évaluation

NOTE 1 Les éléments du profil sont calculés du début à la fin de la longueur d'évaluation et vice versa.

NOTE 2 Les portions positives ou négatives du profil évalué en début ou en fin de longueur d'évaluation ne doivent pas être considérées comme des saillies ou des creux du profil.

Page 12, article 4.1.4

Remplacer par :

4.1.4

hauteur moyenne des éléments du profil

P_c , R_c , W_c

valeur moyenne des hauteurs des éléments du profil, Z_t , à l'intérieur de la longueur d'évaluation

$$P_c, W_c, R_c = \frac{1}{m} \times \sum_{i=1}^m Z_{t_i}$$

Voir Figure 9.

NOTE Les paramètres P_c , W_c , R_c nécessitent une discrimination de hauteur et une discrimination d'espacement. La hauteur minimale des saillies du profil et des creux du profil est de 10 % de P_z pour P_c , de 10 % de W_z pour W_c et de 10 % de R_z pour R_c . L'espacement minimal des saillies du profil et des creux du profil est de 1 % de la longueur de base.

Page 15, article 4.3.1

Remplacer par :

4.3.1

largeur moyenne des éléments du profil

P_{Sm} , R_{Sm} , W_{Sm}

valeur moyenne des largeurs des éléments du profil, X_s , à l'intérieur d'une longueur d'évaluation

$$P_{Sm}, W_{Sm}, R_{Sm} = \frac{1}{m} \times \sum_{i=1}^m X_{s_i}$$

Voir Figure 10.

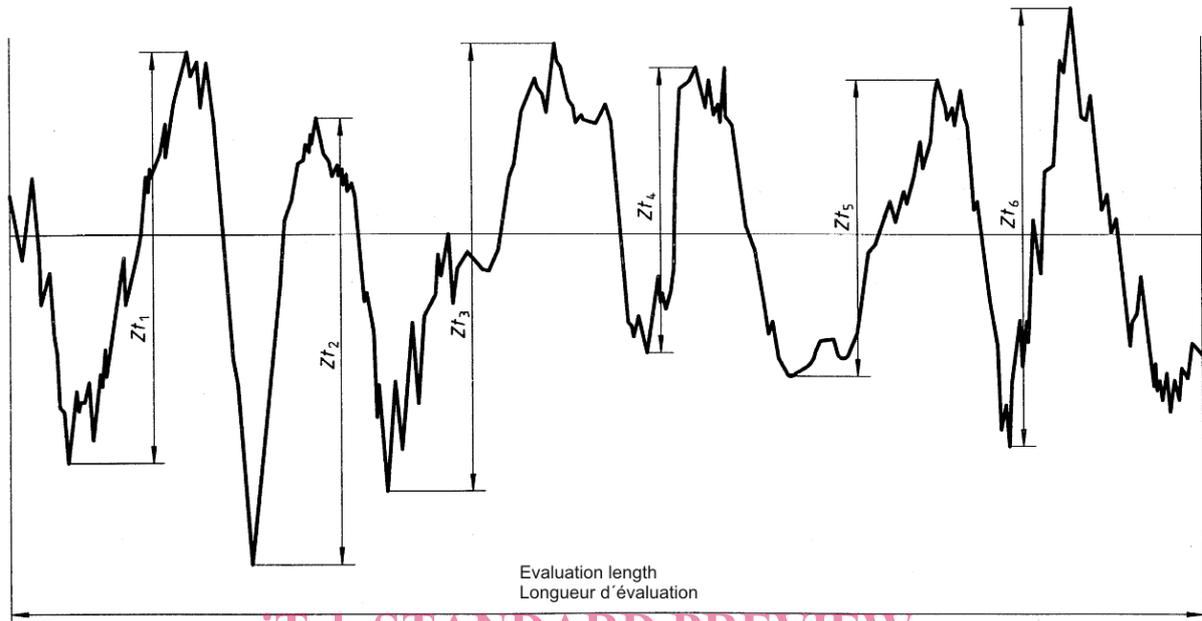
iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 4287:1997/DAMd 2](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a2dd5de6-ff40-4ce5-b931-59186a493f7c/iso-4287-1997-damd-2)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a2dd5de6-ff40-4ce5-b931-59186a493f7c/iso-4287-1997-damd-2>

NOTE Les paramètres P_{Sm} , W_{Sm} , R_{Sm} nécessitent une discrimination de hauteur et une discrimination d'espacement. La hauteur minimale des saillies du profil et des creux du profil est de 10 % de P_z pour P_{Sm} , 10 % de W_z pour W_{Sm} et de 10 % de R_z pour R_{Sm} . L'espacement minimal des saillies du profil et des creux du profil est de 1 % de la longueur de base.

Page 13, Figure 9
Remplacer par :



ITeH STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Page 15, Figure 10
Remplacer par :

